

戦略的創造研究推進事業（CRESTタイプ） 研究員募集のご案内

研究領域「次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」の研究課題名「極微細加工用レジスト研究とプロセスシミュレーターの開発」（代表者：田川精一（大阪大学））の研究員を募集します。次世代及び将来の半導体デバイスの量産プロセスではレジスト材料・プロセスの高感度化・ナノ空間での反応制御が必須となります。究極のリソグラフィであるEUV（極端紫外光）リソグラフィ用のレジストや電子線レジストの反応機構の科学的な基礎基盤を早急に確立し、それに基づいた材料・プロセスの設計指針の創出が熱望されています。物質と放射線との相互作用や放射線化学（パルスラジオリシス法等の実験手段も含む）、機能性材料の合成、有機薄膜等での電荷・プロトンの挙動や反応、プロセスシミュレーションや計算化学、EUV・放射光・X線レーザーなどを用いた広くEUVに関連の研究、DNA・高分子の照射効果、イオン・放射光・陽電子（ミュオン）・中性子等のビームを用いた研究（光電子分光法などの測定方法も含む）、ナノテクノロジー（合成・加工・計測いずれでも）などのどれか一つもしくは複数の分野の研究実績のある人でレジストの研究に興味がある人を募集しています。ただし、熱意があれば上記のbackgroundでなくても考慮します。

勤務地：大阪大学産業科学研究所

所在地：大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1（吹田キャンパス）

職種：研究員

勤務・雇用形態：常勤（年俸制）。大阪大学の規定に従う。

任期：原則単年度更新。最長平成25年3月まで。

募集人員：若干名

研究分野：レジスト

応募資格：博士取得（平成21年3月見込みも可）者

募集期限：平成20年9月30日（適任者があり次第締切る可能性あり）

採用時期：随時及び平成21年4月1日（応相談）

応募書類：

- 1) 履歴書（写真貼付）
- 2) 業績リスト
- 3) 主要論文（PDF）3部以内
- 4) 研究実績の概要（A4二枚以内）
- 5) 志望動機と将来への抱負（A4二枚以内）
- 6) 意見を伺える方の氏名・連絡先（1，2名）

選考方法：書類選考後、面接

採否の決定：Emailにより通知する。

書類送付・連絡先：応募書類はEmailで tagawa@sanken.osaka-u.ac.jp に送付